

Установка плазмохимического осаждения Vision 310 PECVD



Производитель:

Plasma-Therm

Цена:

Цена по запросу

Описание

Установка плазмохимического осаждения Vision 310 PECVD компании Plasma-Therm— это компактная, надежная, технологически гибкая и простая в эксплуатации и обслуживании установка плазмостимулированного осаждения из газовой фазы для R&D-лабораторий и мелкосерийных производств.

Установка Vision 310 PECVD позволяет осаждать следующие материалы:

- Диэлектрики: SiO₂, SiN_x, SiO_xN_y.
- Полупроводниковые материалы: SiC, a-Si.

Ключевые преимущества установки Vision 310 PECVD:

- Большая область загрузки — круглый стол диаметром 305 мм, который позволяет обрабатывать подложки разных форм и размеров.
- Изменяемое расстояние между газовым душем и электродом.
- Равномерность осаждения по толщине и воспроизводимость результатов от пластины к пластине — лучше $\pm 2\%$.
- В комплекте с установкой поставляется библиотека стандартных технологических процессов, которые гарантируются производителем.
- Простой, интуитивно понятный интерфейс.
- История аварийных сообщений, контроль рецептов в процессе работы — вывод данных о процессе на дисплей в режиме реального времени.
- Программное обеспечение позволяет записывать параметры процессов для дальнейшего анализа.
- Возможность удаленного управления и контроля состояния системы.
- Многоуровневый доступ пользователей.
- Наличие различных вариантов системы отслеживания окончания процесса (OES, OEI, LEPD).
- Современная архитектура на основе ПЛК и DeviceNet: безопасная работа, легкая диагностика и минимальное количество проводов.
- Простота использования и обслуживания.
- Малая занимаемая площадь $< 0,7$ м².
- Возможность установки через стену чистого производственного помещения.
- Опциональное оснащение боксом для работы с токсичными и коррозионными газами.
- Возможность изготовления опций и оснастки «под заказ».

Стандартная комплектация

- Система отслеживания окончания процесса:
 - Оптическая эмиссионная спектроскопия (OES)
 - Оптическая эмиссионная интерферометрия (OEI)
 - Лазерная интерферометрия (LEPD)
- Сухой форвакуумный насос
- Дополнительные газовые линии (до 10 в сумме)
- Расширение температурного интервала электрода (например, $-25...+60$ С, либо диапазон на заказ)
- Перчаточный бокс
- Специальные держатели образцов
- Нагреватели вакуумной камеры и вакуумного тракта
- Удаленный мониторинг состояния системы SECS/GEM

- Пакет для установки через стенку ЧПП
- Размещение газового шкафа отдельно от каркаса установки
- Расширенная гарантия производителя
- Специальные опции под заказ